

УДК 535.37

© 1991

УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ

А. Н. Старухин, Г. В. Михайлов, А. Г. Панфилов,
Г. Р. Позина, Б. С. Разбирин, П. П. Сырников, А. А. Буш

Исследованы линейчатые спектры фотолюминесценции первоскитоподобных металлооксидных соединений (МОС), в том числе сверхпроводящих, в ближней ультрафиолетовой области спектра. Изучены зависимость положения, полуширины и интенсивности спектральных линий от состава и условий приготовления образцов, интенсивности возбуждающего света и температуры в интервале от 2 до 300 К. Показано, что фотолюминесценция во всех исследованных МОС имеет общую природу и обусловлена синглетом присутствующих в их составе микрочастиц окиси цинка, причем основной вклад в люминесценцию дает аннигиляция электронно-дырочных пар, связанных с адсорбированными на поверхности частиц гидроксильными группами. Получены экспериментальные свидетельства в пользу влияния сверхпроводящей матрицы на температурное поведение ультрафиолетовой фотолюминесценции при низких температурах.

Среди методов исследования физических свойств высокотемпературных (ВТ) сверхпроводников (СП) важное место занимает оптическая спектроскопия. Свою эффективность в изучении колебательной и электронной структур ВТСП уже показали методы комбинационного рассеяния света и ИК-спектроскопии. В то же время, люминесцентные исследования еще не получили достаточного развития, хотя они представляются перспективными для анализа свойств ВТСП, а также природы содержащихся в них примесей.

Свечение ВТСП наблюдается в широком спектральном интервале, от ИК- до УФ-области [1-3]. Его спектр часто имеет сложный вид и состоит из широких полос и узких линий. Линейчатая люминесценция включает в себя а) спектры редких земель в области 2—2.2 эВ [4, 5], б) линии атомарного кислорода и меди в области 2.5—3.1 эВ [6, 7] и в) наиболее яркую особенность — ряд узких линий излучения, проявляющихся как при электронном, так и при фотовозбуждении в ближнем УФ-диапазоне. Настоящая работа посвящена исследованию свойств этой ультрафиолетовой люминесценции (УФЛ).

Первые исследования УФЛ [8, 9] напрямую связывали появление этого излучения с зарождением сверхпроводящей фазы. В работе [10] указывается, что имеется особенность в температурном поведении интенсивности УФ-излучения вблизи T_c (критической температуры перехода в СП-состояние). В дальнейшем [11] была подтверждена чувствительность УФЛ к сверхпроводящему переходу, но подвергался сомнению собственный характер люминесценции (см. также [9, 12-14]). Спектральное сходство этого излучения с излучением кристаллов окиси цинка, подмеченное в [9], позволило предположить в работе [13], что УФЛ ВТСП обусловлена свечением микрокристаллов ZnO, присутствующих в купратных СП в качестве примесной микрофазы. В работе [14] наличие УФЛ связывается с излучением другой примесной фазы — BaCuO₂, также присутствующей в некоторых ВТСП. В то же время в [12] было показано, что УФЛ носит более общий характер: она обнаружена в целом ряде разнородных соеди-

нений. Такое различие взглядов на природу УФЛ обусловлено в значительной степени недостаточностью имеющихся экспериментальных данных.

С целью установления природы узкополосной УФЛ в изучаемых материалах и выявления ее связи с конкретными электронными переходами в данной работе проведено комплексное исследование УФ-фотолюминесценции, включающее в себя сравнительный анализ люминесценции соединений различного состава, анализ ее температурной зависимости и зависимости от интенсивности возбуждающего света.

Экспериментальная методика. Исследовались керамические образцы, поликристаллические пленки и монокристаллы ВТСII, полученные по обычной технологии. В качестве источника возбуждения люминесценции применялся импульсный азотный лазер ЛГИ-505 ($\lambda_{\text{изв.}} = 3371 \text{ \AA}$).

Плотность возбуждения, как правило, не превышала 10 кВт/см^2 . Для регистрации излучения использовался спектральный вычислительный комплекс на базе спектрометра ДФС-12, позволявший получать спектры с разрешением до 1 \AA .

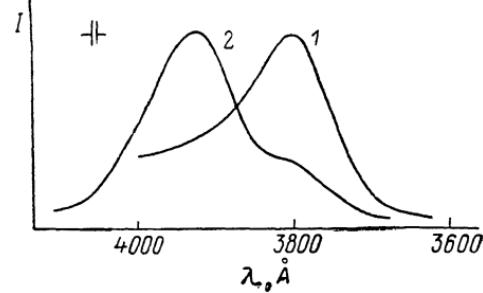
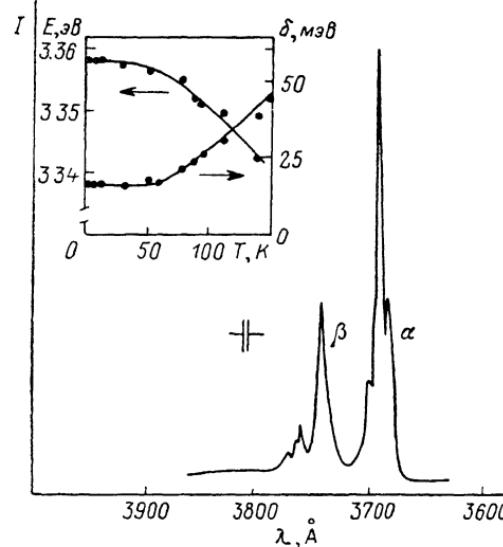


Рис. 2. Спектры УФЛ $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6.8}$ (1) и поликристалла ZnO (2). $T=300 \text{ K}$.

Спектр фотолюминесценции. Спектр ультрафиолетовой люминесценции (УФЛ) СП-керамики $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$ ($T_c \approx 90 \text{ K}$) при температуре 2 К приведен на рис. 1. Он состоит из триплета 3678—3688—3694 \AA и менее интенсивных линий 3742 и 3764 \AA . Относительная интенсивность компонент триплета может существенно меняться от образца к образцу. При записи спектра с меньшим спектральным разрешением триплет сливаются в одну полосу (линия α в обозначениях работы [10]). Триплетный характер полосы α отмечается нами впервые.

С увеличением температуры линии излучения уширяются и смещаются в длинноволновую сторону. Вставка на рис. 1 иллюстрирует температурную зависимость спектрального положения линии α на примере образца $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$. Как видно из этого рисунка, в интервале от 2 до 80 К эта линия излучения смещается незначительно — менее 7 мэВ при полуширине $\approx 20 \text{ мэВ}$, в то время как при дальнейшем повышении температуры происходит быстрое ее смещение (практически линейное с температурой, со скоростью 0.43 мэВ/К), так что при 300 К оно составляет около 90 мэВ.

Аналогичный вид имеет температурная зависимость полуширины линии. В области от 2 до 80 К ее полуширина (δ) почти не меняется. Дальнейший нагрев приводит к быстрому увеличению δ , линейному с температурой (рис. 1). В интервале 80—300 К $\delta \approx 4 \text{ k}_{\text{B}}T$, что свидетельствует о наличии сильного электрон-фононного взаимодействия.

Связь УФЛ с составом МОС. Нами были изучены свойства УФЛ в ряде разнородных металлооксидных соединений (МОС): $\text{MBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$

(M=Y, Pr, Eu, Gd), $[La, Sr]_2CuO_x$ и ВТСП висмутового ряда. Замена иттрия на другие редкоземельные элементы практически не влияет на спектральное положение полос УФ-фотолюминесценции. Аналогичные спектры наблюдаются и в других ВТСП. Следовательно, данное излучение прямо не связано с состояниями атомов редкоземельных элементов, а также бария или стронция, что, в частности, отвергает гипотезу [14] о связи УФЛ с наличием фазы $BaCuO_2$.

Существование этой УФ-люминесценции в монокристаллах $PrBa_2Cu_3O_x$ и $YBa_2Cu_3O_x$ ($x \approx 6$), не являющихся СП, указывает на то, что она не связана непосредственно и с состоянием сверхпроводимости, как предполагали некоторые авторы (см., например, [9, 10]). Об этом же свидетельствует существование УФ-люминесценции при $T > T_c$ (рис. 2). Подробнее о температурной зависимости речь пойдет ниже.

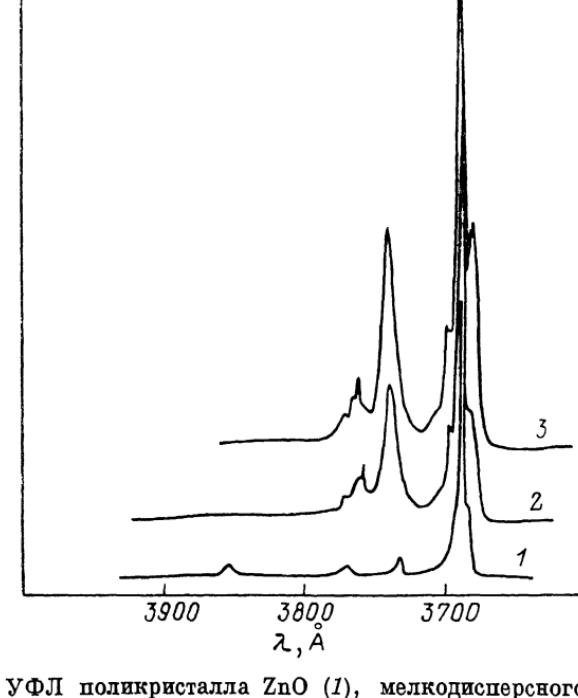


Рис. 3. Спектры УФЛ поликристалла ZnO (1), мелкодисперсного порошка ZnO (2) и керамики $YBa_2Cu_3O_{6.9}$ (3). $T=2$ К.

Приведенные экспериментальные данные позволяют предположить, что УФЛ определяется либо собственными дефектами, связанными с состояниями меди или кислорода (входящих в состав всех исследованных МОС), либо примесью содержащей атомы иных элементов и присутствующей во всех этих веществах.

Связь УФЛ с излучением ZnO . Сходство линейчатого спектра УФЛ $YBa_2Cu_3O_x$ со спектром УФ-излучения кристаллов окиси цинка было отмечено в [9, 13]. Однако при сходстве спектров МОС и кристаллов ZnO между ними имеются и определенные отличия. Наиболее заметна разница между ними при $T \approx 300$ К (рис. 2). Поэтому предположение о связи УФЛ с излучением ZnO требует более тщательного анализа. Мы провели сравнительное исследование спектров люминесценции МОС и различных образцов окиси цинка — монокристаллов разного качества, поликристаллов и спрессованного в таблетки порошка.

При $T=2$ К спектр монокристаллического ZnO отличается от спектров МОС большим количеством линий и меньшей их шириной. Напротив, спектры люминесценции поликристаллического и особенно порошкообраз-

ного ZnO (мелкодисперсного с размером зерен менее 1 мкм) удовлетворительно совпадают со спектрами излучения МОС во всем исследованном интервале интенсивностей возбуждения и температур (рис. 3).

Указанный факт, на наш взгляд, согласуется с предположением [13] о том, что за УФЛ ответственны включения ZnO в основной матрице МОС. При этом в соответствии с исследованиями систем с мелкодисперсными (субмикронными) включениями [15], линейные размеры частиц в нашем случае должны быть не менее нескольких сотен ангстрем. Последнее подтверждается и изучением УФЛ направленно легированных МОС $\text{YBa}_2 \times \times (\text{Cu}_{1-z} \text{Zn}_z)_3 \text{O}_x$ ($z \leq 0.1$),¹ в которых естественно ожидать образования относительно небольших кластеров из атомов цинка и кислорода. По-

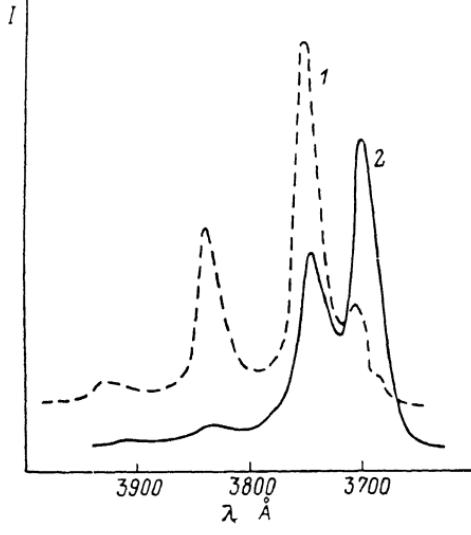


Рис. 4. Спектры УФЛ поликристалла ZnO (1) и $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6.9}$ (2). $T=95$ К.

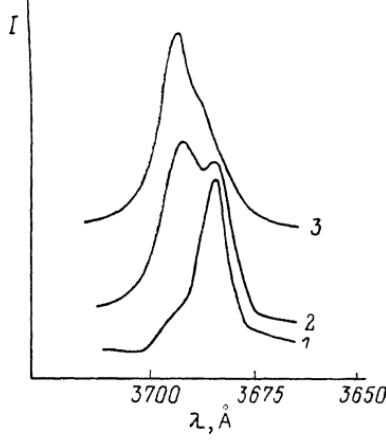


Рис. 5. Зависимость спектра УФЛ $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6.85}$ от интенсивности возбуждения I . $I=I_0, 0.15$ (1), $0.3 I_0$ (2), I_0 (3). $T=2$ К.

скольку интенсивность УФЛ в этих образцах практически не отличалась от интенсивности УФЛ в нелегированных цинком образцах МОС, можно сделать вывод о том, что такие кластеры Zn—O не дают вклада в УФЛ.

Сравнительный анализ УФЛ ZnO и металлооксидных соединений. Дополнительная информация может быть получена путем сравнительного исследования спектров люминесценции ZnO и металлооксидных соединений в широком интервале температур. Спектры излучения поликристаллического образца ZnO и керамического $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$ при $T=95$ К приведены на рис. 4. Видно, что линии в спектре излучения $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$ по спектральному положению с хорошей точностью совпадают с линиями в спектре оксида цинка: линия 3701 Å (α) соответствует излучению электронно-дырочной пары, связанной на нейтральном доноре (3702 Å в ZnO); линии 3742 (β — в обозначениях [10]) и 3835 Å (γ) соответствуют первому и второму фононным повторениям линии свободного экситона в оксидах цинка (3748 и 3833 Å). Наблюдается лишь разница в относительной интенсивности линий в спектрах.

То, что в некоторых образцах металлооксидных соединений удается наблюдать и значительно более слабые, чем линия β , полосы излучения, совпадающие по спектральному положению с линиями излучения свобод-

¹ Содержание цинка в нелегированных образцах МОС, по данным эмиссионного спектрального анализа, составляло $\approx 0.1\%$.

ного экситона в окиси цинка с одновременным рождением двух и трех LO-фононов (в $ZnO \hbar\omega_{LO} = 72$ мэВ), является еще одним подтверждением связи этих полос с излучением ZnO. Необычная для совершенных кристаллов окиси цинка относительно большая интенсивность излучения первого фононного повторения свободного экситона может быть объяснена значительным содержанием дефектов в микрочастицах ZnO [16].

При $T=2$ К совпадение спектра люминесценции керамики МОС со спектром поликристаллического ZnO (рис. 3) ухудшается. В спектре излучения окиси цинка начинают доминировать линии примесного происхождения — линия связанный экситона J_2 и ее фононные повторения (3688, 3770, 3856 Å) [17]. Спектр же УФЛ МОС практически не изменяется, появляется лишь обычно отсутствующая в спектре ZnO линия — 3678 Å (рис. 1). Подобная линия наблюдается в некоторых монокристаллах окиси цинка низкого качества и связывается с аннигиляцией экситонов, связанных на поверхностных дефектах адсорбционного происхождения [18]. Таким образом, полного совпадения в температурных зависимостях спектров излучения окиси цинка и МОС не наблюдается.

Зависимость спектра УФЛ от интенсивности возбуждения. Связь исследуемой люминесценции с примесью микрофазы ZnO согласуется и с наблюдавшейся нами зависимостью спек-

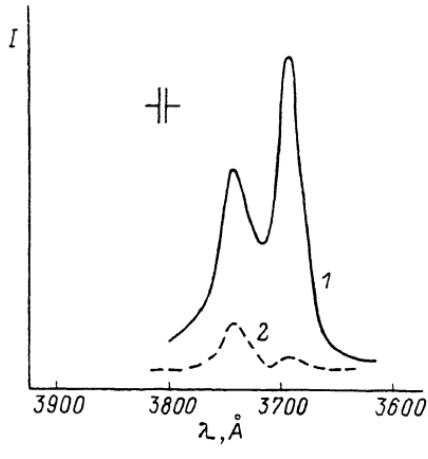


Рис. 6. Влияние отжига на УФЛ $YBa_2Cu_3O_{6.9}$. Спектр образца при $T=2$ К до (1) и после (2) отжига.

тра УФЛ от интенсивности возбуждающего света. С ростом возбуждения компоненты триплета α с $\lambda=3678, 3688$ Å быстро насыщаются и в спектре начинает доминировать линия с $\lambda=3694$ Å, интенсивность которой сверхлинейно зависит от плотности возбуждения (рис. 5). Подобный эффект известен для кристаллов ZnO и связан с оптической перезарядкой примесных центров, что приводит к появлению новых центров излучательной рекомбинации электронов и дырок [19]. Отметим, что в кристаллах окиси цинка при еще более высоких уровнях возбуждения в этом же спектральном диапазоне наблюдается полоса M , обусловленная коллективными явлениями в электронной подсистеме полупроводника. В случае МОС такая полоса отсутствует. Максимум наблюданной линии в отличие от полосы M практически не смещается в длинноволновую сторону с увеличением плотности возбуждения. Отсутствие полосы M мы связываем с сильной дефектностью исследуемых образцов, приводящей к уменьшению времени жизни свободных носителей.

Влияние отжига образцов на спектр УФЛ. Важную информацию о природе примесных центров, ответственных за УФЛ, дали эксперименты по влиянию отжига на спектры излучения. Отжиг проводился в течение часа на воздухе при $T=300$ °C. Подобный отжиг не приводит к заметному изменению содержания кислорода в $YBa_2Cu_3O_x$ [20], но существенно влияет на вид спектра УФЛ отжигаемых образцов. Интенсивность полосы α (3690 Å) после отжига падала более чем на порядок, интенсивность полосы β (3740 Å) — примерно в два раза (штриховая кривая на рис. 6).

Отметим, что и в экспериментах с отжигом наблюдается аналогия в поведении спектров УФЛ МОС и мелкодисперсного порошка окиси цинка. Отжиг порошка ZnO в течение часа при 300 °C также приводит

к резкому (в 4–5 раз) падению интенсивности ультрафиолетового излучения. В то же время аналогичный отжиг поликристаллических образцов и монокристаллов ZnO почти не влияет на интенсивность их свечения. Эффект отжига естественно связать с большим вкладом поверхностных состояний, в частности, абсорбированных молекул, в формирование УФ-люминесценции.

После выдержки отожженного порошка в течение нескольких минут при комнатной температуре на воздухе или в парах воды интенсивность свечения восстанавливается. Заметим, что выдержка порошка в инертной атмосфере, например, в гелии, не оказывает влияния на интенсивность люминесценции. Отметим, наконец, что скорость восстановления свечения в порошке ZnO выше, чем в керамике МОС.

Столь сильное влияние отжига при относительно невысокой температуре свидетельствует в пользу связи УФЛ с абсорбированными примесными молекулами. Согласно [20], при $T > 300$ °C происходит интенсивное выделение из металлооксидного соединения гидратированной воды, гидроксильные группы которой занимают позиции кислорода в кристаллической структуре МОС. Поскольку однозарядные группы OH⁻ оказываются менее прочно связанными, чем ионы кислорода, при нагревании они начинают выделяться при более низкой температуре (300 °C), чем кислород.

Таким образом, можно полагать, что именно гидроксильные группы являются существенной составной частью излучающих центров, ответственных за УФЛ в МОС.² Предположение о связи УФЛ с адсорбированными вблизи поверхности материала примесными молекулами косвенно подтверждается и данными работы [12] о зависимости интенсивности УФЛ от длительности пребывания образцов на воздухе.

Известно [21], что поверхность окислов подвергается гидратации, причем присоединенные группы OH⁻ становятся донорами. С другой стороны, установлено [17], что группа линий связанных экситонов в ZnO (в том числе полоса $J_{\alpha} - \alpha$) возникает при наличии в окиси цинка большой концентрации доноров. Это также свидетельствует в пользу того, что группы OH⁻ являются центрами, ответственными за основные полосы УФЛ.

Температурая зависимость интенсивности УФЛ. Итак, УФЛ связана со свечением микровключений фазы ZnO в основной матрице металлооксидного соединения. Особый интерес в этом случае представляет исследование взаимодействия между примесью и собственно ВТСП, которое должно проявиться, в частности, в зависимости интенсивности УФЛ от температуры. Наблюдавшуюся в работах [10, 11] особенность в поведении УФЛ при $T \approx T_c$ можно было бы связать с влиянием на примесь сверхпроводящей матрицы. Заметим, однако, что в наших экспериментах мы не зарегистрировали такой особенности.

Иным проявлением влияния матрицы ВТСП в сверхпроводящем состоянии на примесную УФЛ, на наш взгляд, является наблюдавшаяся нами необычная зависимость интенсивности основной полосы α от температуры при $T < T_c$.

Как правило, интенсивность полосы α максимальна при низких температурах ($T \approx 2$ K) и монотонно спадает с повышением T , что находит свое естественное объяснение в рамках предложенной выше интерпретации полосы. Действительно, в результате повышения температуры должна происходить тепловая ионизация связанных экситонов, что и приводит к уменьшению интенсивности соответствующих линий излучения [22]. Именно такое поведение примесных полос люминесценции наблюдается в полупроводниковых кристаллах (в том числе — в окиси цинка).

Однако в ряде образцов металлооксидных соединений нами наблюдался качественно иной, немонотонный, вид зависимости интенсивности полосы α от температуры. В этих образцах интенсивность УФЛ при $T = 2$ K отно-

² В работе [6] указывалось на связь УФЛ с решеточным кислородом в ВТСП. Однако в условиях эксперимента [6] с не меньшей эффективностью, чем кислородная дегазация ВТСП, должна была происходить десорбция OH⁻.

сительно мала (в некоторых образцах ее даже не удается зарегистрировать), с повышением температуры она увеличивается, достигая максимальной величины при 10—20 К, а затем быстро спадает (рис. 7). Такая немонотонная зависимость интенсивности примесной люминесценции от температуры необычна для полупроводниковых материалов и мы связываем ее с влиянием сверхпроводящей матрицы. Это влияние должно быть максимальным в области контакта между частицами полупроводниковой фазы ZnO и сверхпроводящей фазой. Можно предположить, что наличие спаренных носителей заряда в приконтактной области полупроводника уменьшает вероятность захвата носителей поверхностными примесными центрами и, как следствие, приводит к уменьшению интенсивности рекомбинационного излучения через эти центры пропорционально доле «нормальных» носителей заряда. В результате интенсивность излучения

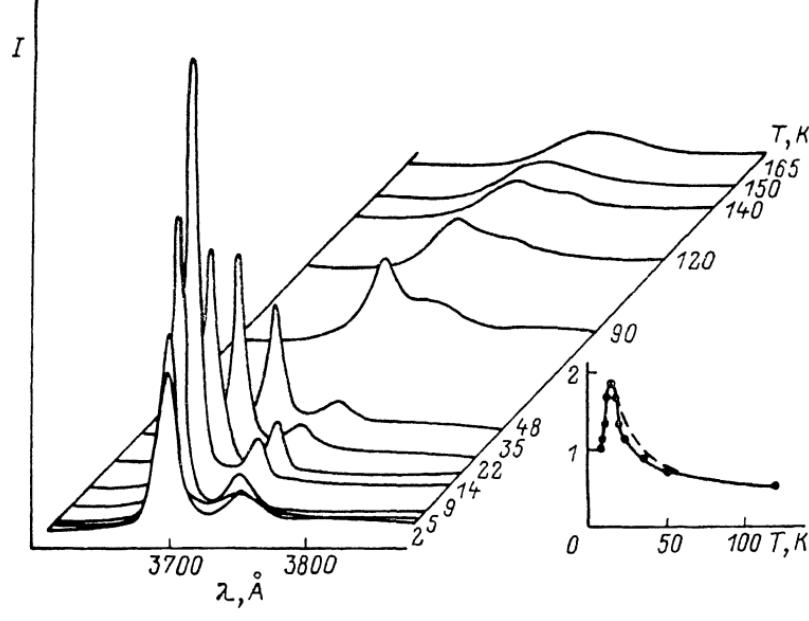


Рис. 7. Зависимость спектра УФЛ $\text{GdBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6.9}$ от температуры.

На вставке — аналогичная зависимость интенсивности полосы α от температуры для образца $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6.9}$. Сплошная линия — эксперимент, штрихи — теория.

поверхностными центрами в полупроводнике, контактирующем со сверхпроводящей фазой, будет минимальна при низких температурах.

С повышением температуры в связи с увеличением доли нормальных носителей [23] интенсивность излучения должна возрастать вплоть до критической температуры $T_{c,s}$ на границе раздела ($T_{c,s} < T_c$ [24]), при которой все носители в полупроводнике перейдут в нормальное состояние. При $T > T_{c,s}$ должно наблюдаться обычное температурное тушение примесной люминесценции за счет тепловой ионизации центров [22].

В этой простой модели зависимость интенсивности УФЛ от температуры описывается выражением

$$I(T) \sim \frac{f(T)}{1 + B \exp(-E_0/k_B T)}, \quad f(T) = \begin{cases} (T/T_{c,s})^4, & T \leqslant T_{c,s}, \\ 1, & T > T_{c,s} \end{cases} \quad (1)$$

E_0 — энергия активации примеси.

В других образцах — с обычной монотонной зависимостью интенсивности полосы α от температуры, — по-видимому, отсутствует прямой контакт между частицами ZnO и сверхпроводящей фазой, например, из-за деградации СП на границе раздела [25]. В этом случае носители заряда в полупроводнике во всем интервале температур находятся в нормальном

состоянии, что и определяет обычный монотонный ход температурной зависимости интенсивности УФЛ ($f(T) = \text{const}$).

В реальных материалах влияние сверхпроводящей матрицы испытывает лишь часть микровключений, и поэтому зависимость $I(T)$ будет иметь более сложный вид

$$I(T) \sim \left[\frac{1 - x}{1 + B \exp(-E_0/k_B T)} + \frac{x \cdot f(T)}{1 + B \exp(-E_0/k_B T)} \right]. \quad (2)$$

Со временем, по мере деградации образцов, т. е. с увеличением в образцах доли диэлектрической фазы (с уменьшением константы x в формуле (2)), немонотонная зависимость интенсивности УФЛ от температуры должна все более и более приближаться к обычной монотонной, что и наблюдается экспериментально (штриховая кривая на рис. 7 соответствует $x \approx 1/2$).

Полученные результаты указывают на необходимость дальнейших исследований примесной люминесценции ВТСП, поскольку изучение взаимного влияния примеси и СП-матрицы люминесцентными методами может дать дополнительную информацию как о процессах на границе раздела сверхпроводник (ВТСП)—полупроводник, так и о свойствах собственно ВТСП.

Список литературы

- [1] Лущик Ч. Б. и др. // Изв. АН СССР, сер. физ. 1988. Т. 52. № 4. С. 685—690.
- [2] Елисеев А. П. и др. // СФХТ. 1989. Т. 2. № 12. С. 60—65.
- [3] Фуголь И. Я. и др. // ФНТ. 1989. Т. 15. № 11. С. 1301—1310.
- [4] Tissue B. M., Wright J. C. // J. Lumin. 1987. V. 37. N 3. P. 117—121; 1988. V. 42. N 4. P. 173—180.
- [5] Agladze N. I. et al. // Sol. St. Comm. 1989. V. 69. N 4. P. 385—386.
- [6] Еременко В. В. и др. // ФНТ. 1988. Т. 14. № 8. С. 882—885.
- [7] Фуголь И. Я. и др. // ФНТ. 1988. Т. 14. № 10. С. 1104—1108.
- [8] Лущик Ч. Б. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1987. Т. 46. № 3. С. 122—124.
- [9] Лущик Ч. Б. и др. // ФТТ. 1987. Т. 29. № 12. С. 3667—3672.
- [10] Еременко В. В. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1988. Т. 47. № 10. С. 529—531.
- [11] Панфилов А. С. и др. // ФНТ. 1989. Т. 15. № 7. С. 792—797.
- [12] Попова М. Н. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1988. Т. 48. № 11. С. 616—618.
- [13] Гайсин В. А. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1989. Т. 49. № 11. С. 597—599.
- [14] Горн И. А. и др. // Тез. докл. II Всес. конф. ВТСП. Киев, 1989. Т. II. С. 147.
- [15] Ekimov A. I. et al. // Sol. St. Comm. 1985. V. 56. N 11. P. 921—924.
- [16] Вербин С. Ю. и др. // ФТТ. 1977. Т. 19. № 11. С. 3468—3470.
- [17] Кузьмина И. П., Никитенко В. А. Окись цинка. М.: Наука, 1984. 166 с.
- [18] Савишин С. Ф. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1989. Т. 50. № 3. С. 113—116.
- [19] Разбираин Б. С. и др. // ФТТ. 1986. Т. 28. № 9. С. 2808—2812.
- [20] Филатов С. К. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1989. Т. 50. № 4. С. 32—34.
- [21] Моррисон С. Химическая физика поверхности твердого тела. М.: Мир, 1980. 488 с.
- [22] Гельмонт Б. Л. и др. // ЖЭТФ. 1988. Т. 94. № 3. С. 322—335.
- [23] Дмитренко И. М. В мире сверхпроводимости. Киев: Наукова думка, 1981. 196 с.
- [24] Алфеев В. Н. Полупроводники, сверхпроводники и параэлектрики в криоэлектронике. М.: Сов. радио, 1979. 311 с.
- [25] Соколов А. Н. и др. // ЖНХ. 1989. Т. 34. № 8. С. 1923—1927.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН СССР
Ленинград

Поступило в Редакцию
25 июля 1990 г.